

عنوان مقاله:

تهیه و بررسی هتروپلی اسیدهای تنگستن نشانده شده بر روی اکسیدهای فلزی و نافلزی

محل انتشار:

دومین همایش دانشجویی فناوری نانو (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

علی اکبر طرلانی - دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

مصطفی محمدپور امینی - دانشگاه شهید بهشتی، گروه شیمی

منصور عابدینی - دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

خلاصه مقاله:

هترو پلی اسید داوسن ($H_6P_2W_{18}O_{62}$) بر روی بستر های آلومین تجای و سل - ژل نشانده شده و با BET, SEM, XRD, DSC, TGA, IR مورد بررسی قرار گرفت. هتروپلی اسید داوسن که به صورت خالص در دمای 350 درجه سانتی گراد تخریب می شود. بر روی بسترهای آلومین تا دمای 650 درجه سانتی گراد پایدار می ماند. BET, SEM نشان داد نانو حفره های الومین سل - ژل نسبت به آلومین تجاری یکنواخت تر و دارای مساحت سطح بالاتر است. هتروپلی اسیدهای کگین ($H_2PW_{12}O_{40}$) و پرایسلر ($H_{14}NaP_5W_{30}O_{110}$) بر روی بسترهای سیلیسی مزوپور، سیلیکاژل و فیوم سیلیکای عامل دار شده نشانده شد و با ICP, CHN, BET, L.A, XRD, DSC-TGA, IR بررسی شد. نتایج نشان داد که این هتروپلی اسیدها بر روی بسترهای عامل دار شده با C_2H_5O , $Si(CH_2)$, NH_2 به خوبی تثبیت شده اند. بیشترین درصدعامل آمین بر روی نانو حفره های مزوپور و بیشترین درصد هتروپلی اسید بر روی بستر فیوم سیلیکا قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

آلومین، آمینوسیلان، تثبیت، سیلیس، مزوپور، نانو حفره، هتروپلی اسید

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/22949>

